

21世紀 COE プログラム「原子論的生産技術の創出拠点」第4回シンポジウム
精密工学会2004年度秋季大会シンポジウム
精密工学会 超精密加工専門委員会 第53回研究会

『EUVリソグラフィ技術の最前線』

【日時】 平成16年9月17日(金) 13:00~16:50

【場所】 精密工学会2004年度秋季大会会場

島根大学 教養棟2号館3F604教室

(〒690-0823 島根県松江市西川津町1060)

大会中総合受付専用電話 090-3507-1791

【趣旨】 デザインルールが50nm時代の半導体デバイス工程におけるリソグラフィ技術として、極端紫外線を用いた縮小投影露光技術(EUVリソグラフィ)が期待されています。現在、日本では経済産業省が主導して組織された技術研究組合「極端紫外線露光システム技術開発機構: EUVA」を中心として研究開発が進められています。本シンポジウムでは、EUVリソグラフィ技術分野における研究開発の現状と将来の展望について、最先端で研究に携わっておられる方々にご講演いただきます。奮ってご参加ください。

【プログラム】

- | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 13:00 - 13:30 | 「EUVリソグラフィ開発の技術戦略」
EUVAプロジェクトリーダー | 堀池 靖浩 氏 |
| 13:30 - 14:10 | 「EUVL用レーザー生成プラズマ光源の開発」
EUVA平塚研究開発センタ | 小森 浩 氏 |
| 14:10 - 14:50 | 「EUVL用ディスチャージ生成プラズマ光源の開発」
EUVA研究開発センタ御殿場分室 | 佐藤 弘人 氏 |
| 14:50 - 15:10 | 休憩 | |
| 15:10 - 16:10 | 「EUV露光装置用光学素子加工技術の開発」
EUVA相模原研究開発センタ
EUVA下丸子研究開発センタ | 瀧野 日出雄 氏
安藤 学 氏 |
| 16:10 - 16:50 | 「EUV光学系絶対波面計測技術の開発」
EUVA相模原研究開発センタ | 村上 勝彦 氏 |

【参加費】 無料

参加ご希望の方は、所属と氏名を9月14日までに、下記宛メールでご連絡ください。

21世紀 COE「原子論的生産技術の創出拠点」事務局 21coe@upst.eng.osaka-u.ac.jp